



Das Institut für Optische Technologien lädt ein zum Kolloquiumsvortrag

EUV-Optiken von ZEISS: Die präzisesten Spiegel der Welt, um das Moore'sche Gesetz fortzuschreiben

Dr.-Ing. Patric Büchele

Product Systems Engineering Projection, ZEISS Semiconductor
Manufacturing Optics, Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen

Wie funktioniert optische Lithographie mit extrem ultravioletter Strahlung (EUV)? Welche Anforderungen ergeben sich für Optiken aufgrund von EUV und wie werden diese gemeistert? Inwieweit hilft uns das von Ernst Abbe, Mitbegründer der modernen Optik als auch kongenialer Partner von Carl Zeiss, beschriebene heute noch gültige Abbe-Limit bzw. die Auflösungsgrenze, die kritischen Dimensionen einer Lithographie-Struktur zu verstehen?

In diesem Vortrag wird ein Abriss über die verschiedenen Generationen der Lithographie-Optiken von ZEISS gegeben. Es wird gezeigt, wie diese eingesetzt werden und wo sich künftige Generationen hin entwickeln. Es werden Einblicke in die Herausforderungen bei der Herstellung und Messtechnik von EUV-Optiken gegeben und auch in den Betrieb der Optiken mit EUV-Strahlung, der eine unglaubliche Komplexität erfordert, welche durch bahnbrechende Errungenschaften von ZEISS ermöglicht wird.

Einladender: Prof. Dr. Ulrich Wittrock

Prof. Dr. Michael Bredol
Prof. Dr. Evgeny Gurevich
Prof. Dr. Thomas Jüstel
Prof. Dr. Ulrich Kynast
Prof. Dr. Konrad Mertens
Prof. Dr. Michael Schäferling
Prof. Dr. Ulrich Wittrock

www.fh-muenster.de/iot

Ort:
Raum D 145
(Gebäudeteil D, Parkplatz P3)
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt

Datum:
Mittwoch, 09.11.2022

Uhrzeit:
17.00 Uhr c. t.

